

© 1992

**О ВОЗМОЖНОСТИ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ДЖОЗЕФСОНОВСКОГО КОНТАКТА  
ПО ЕГО ШУМОВЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ**

*B. M. Закосаренко, E. B. Ильичёв*

Показано, что источником фликкер-шума в керамических ВЧ-сквидеах из ВТСП является слабая связь. Из уравнения экспериментальных результатов с оценками шумов по модели ДУС следует, что модель непротиворечиво описывает низкочастотный шум джозефсоновского контакта в керамике, причем наиболее правдоподобным является контакт типа  $S-N-S$ .

Проблема низкочастотного электрического шума в различных материалах давно привлекает внимание исследователей. В частности, для высокотемпературных сверхпроводников она особенно актуальна из-за возможного использования сквидов из ВТСП для высокочувствительных измерений.

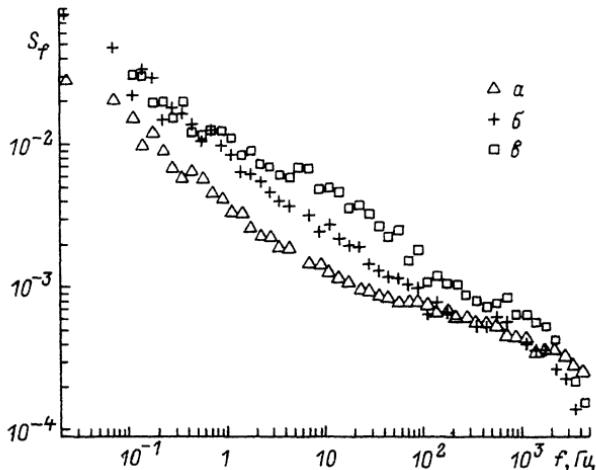
На данном этапе исследователи связывают наличие шума  $1/f$  с термоактивированным движением магнитного потока в поликристаллической керамике. Прыжки одиночного вихря между центрами пиннинга дают вклад в спектральную плотность шума на своей характерной частоте с лоренцевским спектром. Распределение множества таких процессов приводит к наблюдаемому  $1/f$  спектру [1, 2].

С другой стороны, недавно была построена теория низкочастотных электрических шумов (теория двухуровневых систем — ДУС) в неупорядоченных проводниках и туннельных структурах [3] на основе модели мягких ангармонических потенциалов [4]. Авторы [5] рассмотрели эту теорию применительно к металлооксидным сверхпроводникам и, в частности, к сквидам на их основе.

Представленная работа посвящена выяснению причин наличия низкочастотного шума в ВТСП-сквидеах и является первой попыткой количественных оценок экспериментальных результатов на основе теории ДУС.

Исследуемые датчики ВЧ-сквида были изготовлены из керамики  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$  и представляли собой кольцо, замкнутое мостиком. Внутренний диаметр кольца 1 мм, толщина стенки  $\sim 1$  мм, высота  $\sim 4$  мм, размер мостика порядка 30 мкм. Образцы были изготовлены способом, аналогичным изложенному в [6]. В отверстие датчика вставлялась катушка резонансного контура, подключенного к стенду [7] для записи характеристик ВЧ-сквида. Все измерения проводились в жидком азоте при температуре  $T = 77$  К. Датчик сквида помещался в центре сверхпроводящего экрана, представляющего собой цилиндр из иттриевой керамики высотой 90 мм с внутренним диаметром 12 мм, толщиной стенок  $\sim 3$  мм. Кроме того, весь криостат помещался в пермаллоевый экран.

Для измерения спектральной плотности шума напряжение с резонансного контура  $U$  после усиления и детектирования подавалось на спектрометр на основе персональной ЭВМ типа IBM PC/AT. Массив значений  $U$ , эквидистантно распределенных во времени и усредненных за интервал между измерениями, записы-



Спектр шума магнитного потока в ВЧ-сквидеах, нормированный на  $\Phi_0$  с использованием экспериментально определенного коэффициента преобразования  $\eta = 15$  (а), 6 (б), 3 мкВ/ $\Phi_0$  (в).

вался в память ЭВМ. Из полученной зависимости  $U(t)$  вычиталась линейная составляющая и проводилось преобразование Фурье. Спектральная плотность шума приводилась к магнитному потоку в сквиде с помощью экспериментально определенного коэффициента преобразования.

Исследуемый сквид работал в безгистерезисном режиме, подробно описанном в [8], т. е. его безразмерная индуктивность  $\beta_e = 2\pi L_s I_c \Phi_0 < 1$ . Здесь  $L_s$  — индуктивность кольца,  $I_c$  — критический ток слабой связи,  $\Phi_0 = 2.07 \cdot 10^{-15}$  Вб — квант магнитного потока.

На рисунке представлен спектр шума  $S_f$  для двух образцов с одинаковыми геометрическими размерами, изготовленных из одной и той же керамики, но отличающихся коэффициентом преобразования. Кривая  $\nu$  записана на том же образце, что и кривая  $\delta$  после уменьшения  $I_c$ . Если предположить, что из-за термоактивированного движения магнитного потока в теле датчика возникает шумовой поток через контур сквида, т. е. сквид регистрирует шум от внешнего источника, то для данных образцов  $S_f$  не должна различаться. Заметное отличие между кривыми дает веские основания полагать, что в наших экспериментах источником шума является слабая связь.

Таким образом, дальнейший анализ будет проведен в рамках модели ДУС, где предполагается, что шум обусловлен флюктуациями джозефсоновского тока. В [5] для флюктуаций магнитного потока  $\varphi_\omega$  в безгистерезисном ВЧ-сквиде получено выражение

$$\langle |\varphi_\omega|^2 \rangle = [\sin^2 \varphi / (\cos \varphi + 1/\beta_e)] S, \quad (1)$$

где  $\varphi$  является решением уравнения  $\varphi + \beta_e \sin \varphi = \varphi_e$ , а  $\varphi$  и  $\varphi_\omega$  — поток, нормированный на  $\Phi_0 / 2\pi$ . В формуле (1)

$$S = \alpha / N_e f, \quad (2)$$

где  $N_e$  — число электронов в образце,  $\alpha$  — параметр Хоуге [9]. Оценка  $\alpha$  для туннельного контакта имеет вид

$$\alpha / N_e = d \langle (\sigma_1 - \sigma_2)^2 \rangle P T / A, \quad (3)$$

Здесь  $\sigma_{1,2}$  — сечения рассеяния электрона,  $P$  — плотность состояний двухуровневой системы,  $T$  — температура,  $A$  — площадь туннельного контакта,  $d$  — толщина перехода.

Для контакта, который является сужением между двумя сверхпроводниками, параметр Хоуге определяется из

$$\alpha/N_e = l^2 \langle (\sigma_1 - \sigma_2)^2 \rangle PT/r^3, \quad (4)$$

где  $l$  — длина свободного пробега по отношению к рассеянию на остальных (нефлуктуирующих) примесях,  $r$  — характерный размер контакта.

Числовые значения сечений рассеяния и плотности состояний не определяются из наших экспериментов. Однако в работе [5] приведены оценки для этих величин  $\sigma_1 - \sigma_2 \approx 5 \cdot 10^{-15} \text{ см}^2$ ,  $P \approx 4 \cdot 10^{33} \text{ эрг}^{-1} \cdot \text{см}^{-3}$ . Это позволяет в предположении, что теория низкочастотных электрических шумов верна, сделать выводы о типе джозефсоновского контакта в сквиде и оценить его размеры.

Итак, зададимся значением шумового потока на частоте 1 Гц  $3 \cdot 10^{-3} \Phi_0$  (см. рисунок, кривая  $a$ ). Выбор кривой  $a$  обусловлен тем, что для этого образца  $\beta_e \approx 1$ . Зная  $L_s \approx 3 \cdot 10^{-10} \text{ Гн}$ , определяем  $I_c \approx 1 \text{ мА}$ . Далее, используя (1), (2) и (3), определим  $A$ . Здесь ширина контакта  $d \approx \xi$ , где  $\xi \approx 10 \text{ \AA}$  — длина когерентности [10]; значения плотности состояний и сечений рассеяния приведены выше,  $T = 77 \text{ К}$ . Выбирая коэффициент в (1) при  $S$  порядка 1, получаем  $A \approx 2.5 \cdot 10^{-13} \text{ см}^2$ . Отсюда критическая плотность туннельного тока оказывается  $j \approx 4 \cdot 10^6 \text{ А/см}^2$ . По порядку величины это значение очень велико, и представляется весьма сомнительным возможность существования такого контакта. В частности, для низкотемпературных сверхпроводящих туннельных структур, технология изготовления которых достаточно отработана, значение  $j \approx 10^6 \text{ А/см}^2$  наблюдалось, по-видимому, только в одной работе [11] и является рекордным.

Если слабая связь в интерферометре образована закороткой между зернами в керамике, то, используя (4), (2) и (1), можно определить  $r$ . Все числовые значения физических величин здесь такие же, как и в предыдущем случае. Длина свободного пробега  $l \approx 10 \text{ \AA}$  взята из работы [10]. В результате аналогичных вычислений получаем характерный размер точечного контакта  $r \approx 3 \cdot 10^{-7} \text{ см}$  и его критическую плотность тока  $j \approx 10^7 \text{ А/см}^2$ . В принципе такие большие значения  $j$  наблюдались в иттриевой системе на тонких пленках ( $j \approx 5 \cdot 10^6 \text{ А/см}^2$  [12]). Однако мы считаем крайне маловероятным, что в керамическом мостике с характерным размером 30 мкм слабым местом является единственная закоротка с таким малым размером (30  $\text{\AA}$ ) и с такой большой плотностью тока.

Проанализируем случай слабой связи сверхпроводник — нормальный металл — сверхпроводник ( $S-N-S$ ). Хотя точных расчетов для такого контакта в [5] не приводится, для оценок можно воспользоваться выражением (3). Здесь роль  $\xi$  играет длина когерентности в нормальном металле  $\xi_N$ , которая в «грязном»  $N$ -металле,  $l \ll \xi_N$  по оценкам [13], составляет  $\approx 2 \cdot 10^{-6} \text{ см}$ . Результаты вычислений дают  $A \approx 5 \cdot 10^{-12} \text{ см}^2$ . Отсюда критическая плотность тока получается более разумной ( $j \approx 2 \cdot 10^5 \text{ А/см}^2$ ), чем в предыдущих случаях.

Итак, теория ДУС непротиворечиво описывает низкочастотные шумы в ВТСП-керамике, причем наиболее правдоподобной выглядит модель гранулярной структуры с  $S-N-S$  контактами между гранулами. Отметим, что большинство авторов склоняется именно к такой модели строения материала [14, 15].

В заключение мы благодарим В. И. Козуба, Ю. М. Гальперина, И. Б. Левинсона за полезные дискуссии.

## Список литературы

- [1] Koch R. H., Malozemoff A. P. // Adv. in Supercond. Proc. 1st Int. Sypos. on Supercond. (ISS'88). August 1988, Nagoya, Japan. P. 675.
- [2] Ferrari M. J., Johnson M., Wellstood F. S., Clarke J., Rosenthal P. A., Hammond R. H., Beasley M. R. // IEEE Trans. Mag. 1989. V. 25. P. 806.
- [3] Гальперин Ю. М., Карпов В. Г., Козуб В. И. // ЖЭТФ. 1989. Т. 95. С. 1123.
- [4] Карпов В. Г., Клингер М. И., Игнатьев Ф. И. // ФЭТФ. 1983. Т. 84. С. 760.
- [5] Гальперин Ю. М., Гуревич В. Л., Козуб В. И. // ФТТ. 1989. Т. 31. С. 155.
- [6] Закосаренко В. М., Ильичёв Е. В., Никифорова Т. В., Тулин В. А. // Письма в ЖТФ. 1987. Т. 13. С. 1389.
- [7] Антонова И. Ю., Закосаренко В. И., Ильичёв Е. В., Розенфланц В. Ж., Тулин В. А. // ЖТФ. 1990. Т. 60. С. 135.
- [8] Закосаренко В. М., Ильичёв Е. В., Тулин В. А. // Письма в ЖЭТФ. 1990. Т. 51. С. 275.
- [9] Hooge F. N., Hoppenbrouwers A. M. H. // Phys. Lett. 1969. V. 29. P. 642.
- [10] Горьков Л. П., Коннин Н. Б. // УФН. 1988. Т. 156. С. 117.
- [11] Kleinsasser A. W., Buhrman // Appl. Phys. Lett. 1980. V. 37. P. 841.
- [12] Курокава Т., Ампо Х., Таяма С. // СФХТ. 1990. Т. 3. С. 773.
- [13] Шмидт В. В. Введение в физику сверхпроводников. М.: Наука, 1982. С. 240.
- [14] Мейлихов Е. З. // СФХТ. 1989. Т. 2. С. 5.
- [15] Kroeger D. M., Choudhary A., Brunestad J., Williams R. K., Padgett R. A., Coghlan W. A // J. Appl. Phys. 1988. V. 64. P. 331.

Институт проблем технологии  
микроэлектроники и особочистых материалов РАН  
Черноголовка  
Московская обл.

Поступило в Редакцию  
15 января 1992 г.